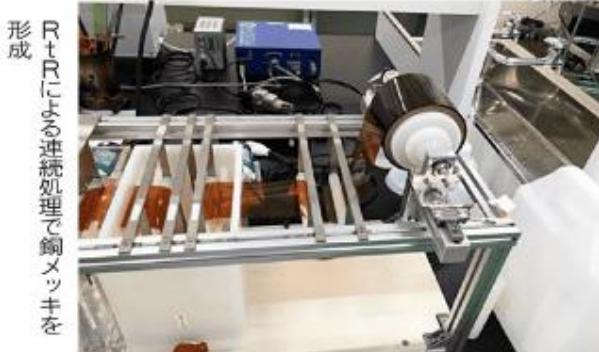


岩手大学の平原英俊教授、大石好行教授らは、5G（第5世代通信技術）以降の高速伝送・高周波に対応する次世代フレキシブル基板（FPC）の開発を推進する。絶縁樹脂と銅の界面が平滑でも密着性が高い分子接合法（i-SB法）による銅メッキ形成技術と、低誘電特性を有するフッ素系、トリアジン系熱可塑性樹脂の合成技術を組み合わせる。銅メッキ形成ではロール・トゥ・ロール（RtR）設備を完成すみで、開発した低誘電樹脂を用いて銅メッキ層板を試作したところ、FPCメーカーが要求する剥離強度を達成している。

岩手大学は内閣府の戦略的イノベーション創造プロジェクト（SIP）で分子接合法による革新的ものづくりの製造技術の研究開発に取り組んできた。異種材料を



岩手大

次世代FPC 5G以降に向けた的

ン・エコシステム形成プログラムでこの技術を発展させ、エレクトロニクス実装分野に応用展開している。

有望な用途の一つが次世代FPC。平原教授らは高温環境下に応応するメッキプロセスを開発。絶縁樹脂を親水化処理し、銅メッキの酸化を防止する有機・無機ハイブリッド材料によるパリア層、分子接合層をそれぞれ形成。その後、触媒を拘持させ、無電解メッキ、電解メッキを施す。

RtR設備で浸漬、塗布による連続処理が可能。パリア層形成に真空蒸着など

銅メッキ 平滑・高密着で

新規の低誘電樹脂も開発

大がかりな装置が不要なため低コスト化が図れる。大石教授らは次世代FPCに求められる低誘電絶縁樹脂の開発を進めている。FPC。平原教授らは高温環境下に応応するメッキプロセスを開発。絶縁樹脂を親水化処理し、銅メッキの酸化を防止する有機・無機ハイブリッド材料によるパリア層、分子接合層をそれぞれ形成。その後、触媒を拘持させ、無電解メッキ、電解メッキを施す。

RtR設備で浸漬、塗布による連続処理が可能。パリア層形成に真空蒸着など

接合する際、エッチングによる表面粗化ではなく、トリアジン誘導体を分子接合剤として用いて強い化学結合を実現する。さらに文部科学省の地域イノベーション・エコシステム形成プログラムでこの技術を発展させ、エレクトロニクス実装分野に応用展開している。

有望な用途の一つが次世代FPC。平原教授らは高温環境下に応応するメッキプロセスを開発。絶縁樹脂を親水化処理し、銅メッキの酸化を防止する有機・無機ハイブリッド材料によるパリア層、分子接合層をそれぞれ形成。その後、触媒を拘持させ、無電解メッキ、電解メッキを施す。

RtR設備で浸漬、塗布による連続処理が可能。パリア層形成に真空蒸着など

は誘電率2.48、誘電正接0.018といった値が得られた。またトリアジン環の窒素-炭素結合は分極しているため無機材料、金属材料との親和性が良好で高い接着性が期待できる。

開発した低誘電樹脂のキヤストフィルムにi-SB法による銅メッキを行ったところ、剥離強度は0.8 kgf (kN) / mm (m) 以上とFPCメーカーが要求する接着性を達成した。

要素技術の開発にめどが立ちつつあるため、今後は企業と高伝送・高周波対応FPCの実用化に取り組みたい考え。低誘電樹脂は透明アントナにも有望となり